

学内共同利用機器一覧 2021.11.25

<<長野(工学)地区>>

基盤研究支援センター 機器分析支援部門長野(工学)分室

設備・システム名	機器構成・型式・会社名	導入年度	用途・性能・概要等	設置場所	所属・管理者名	連絡先(内線)	利用規程・使用料金・依頼分析等	共同利用		
								学内	学外	備考
1 電界放射走査電子顕微鏡	日本電子JSM-7000F	2006	表面形状観察、元素分析	基盤研究支援センター長野分室(W2棟)	技術部 南澤 比佳里	5126	規定あり 使用者負担あり 試料作製依頼なし	○	○	研究基盤共用 事業登録機器
2 電子プローブマイクロアナライザー	島津製作所EPMA-1610	2003	元素分析、表面形状観察等	基盤研究支援センター長野分室(W2棟)	技術部 井上 淳期	5580	規定あり 使用者負担あり 試料作製依頼なし	○	○	研究基盤共用 事業登録機器
3 収束イオンビーム加工観察装置	SII SMI2050	2002	表面観察および微細加工等	基盤研究支援センター長野分室(W2棟)	技術部 助川 公哉	5580	規定あり 使用者負担あり 試料作製依頼なし	○	○	研究基盤共用 事業登録機器
4 微小領域X線回折装置	理学 Rint Rapit	2004	定性、構造解析	基盤研究支援センター長野分室(W2棟)	技術部 堀田 将臣	5580	規定あり 使用者負担あり 試料作製依頼なし	○	○	研究基盤共用 事業登録機器
5 蒸気・窒素吸着装置	日本ベル社	2007	表面積測定等	基盤研究支援センター長野分室(W2棟)	物質工学科 岡田 友彦	5414	規定あり 使用者負担あり 試料作製依頼なし	○	○ (条件あり)	
6 多目的X線回折装置	1. 理学 SmartLab 2. ハイブリッド型多次元ピクセル検出器Hy-Pix-3000	1. 2009 2. 2020	定性、構造解析	基盤研究支援センター長野分室(W2棟)	技術部 井上 淳期	5580	規定あり 使用者負担あり 試料作製依頼なし	○	○ (条件あり)	
7 三次元測定機	ミツトヨ FALCIO-Apex776	2009	高精度三次元測定	機械システム工学科(南棟)	技術部 大谷 武志	5158	規定あり 使用者負担あり 試料作製依頼なし	○	○ (条件あり)	
8 ガスクロマトグラフ質量分析装置	島津 QP2010Ultra	2011	混合物をGCにより分離。各成分の分子量測定、構造推定。二重収束搭載で元素組成解析が可能。	電子情報システム工学科棟(W1)	物質工学科 岡田 友彦	5414	規定あり 使用者負担あり 試料作製依頼なし	○	○ (条件あり)	
9 液体クロマトグラフ/飛行時間型質量分析装置	島津LC-20ADXR/Bruker micrOTOF II	2011	LCにより分離した各成分をイオン化、飛行時間から構造推定、精密質量測定が可能。	電子情報システム工学科棟(W2)	物質工学科 戸田 泰徳	5390	規定あり 使用者負担あり 試料作製依頼なし	○	○ (条件あり)	
10 超伝導高分解能核磁気共鳴測定装置(500MHz)	Bruker AV500	2011	固体・液体の構造解析	基盤研究支援センター長野分室(W2棟)	物質工学科 戸田 泰徳(液体)、岡田 友彦(固体)	5390(戸田) 5414(岡田)	規定あり 使用者負担あり 試料作製依頼なし	○	○ (条件あり)	
11 超伝導高分解能核磁気共鳴測定装置(300MHz)	Bruker AV300N	2011	液体の構造解析	基盤研究支援センター長野分室(W2棟)	物質工学科 戸田 泰徳	5390	規定あり 使用者負担あり 試料作製依頼なし	○	○ (条件あり)	
12 単結晶X線構造回折装置	Bruker Smart APEX II	2011	分子構造解析	基盤研究支援センター長野分室(W2棟)	技術部 菊地 理佳	5126	規定あり 使用者負担あり 試料作製依頼なし	○	○ (条件あり)	
13 電界放射走査型透過電子顕微鏡	日立 HD2300A	2009	高分解能観察、元素分析	基盤研究支援センター(E7棟)	技術部 南澤 比佳里	5126	規定あり 使用者負担あり 試料作製依頼:要相談	○	○	ナノテクノロジー プラットフォーム 事業登録機器
14 イオンミリング装置	日立 IM4000	2011	SEM試料前処理装置	基盤研究支援センター(E7棟)	技術部 菊地 理佳	5126	規定あり 使用者負担あり 試料作製依頼:要相談	○	○ (条件あり)	
15 電界放射型電子顕微鏡(FE-SEM)	S-4100形・日立	1993	電子線で試料上を走査することにより表面構造を拡大観察できる顕微鏡	基盤研究支援センター(E7棟)	技術部 菊地 理佳	5126	規定あり 使用者負担あり 試料作製依頼:可	○	○ (条件あり)	
16 デジタル顕微鏡システム	金属顕微鏡(写真撮影装置付)BX60・オリンパス	1996	各試料の顕微鏡観察、カラーディスプレイ表示、写真撮影	基盤研究支援センター(E7棟)	技術部 井上 淳期	5580	規定あり 使用者負担あり 試料作製依頼:可	○	○ (条件あり)	
17 熱分析装置(TG-DTA)	TG8120・理学	2005	熱的に安定な基準試料と測定試料を同時に加熱・冷却したときの基準試料・測定試料間の温度差を測定して示差熱(DTA)を測定する。また、測定部は重量変化に伴って上下動する構造となっており、測定部の変位を差動トランスで測定して重量変化(TG)を測定する	基盤研究支援センター(E7棟)	技術部 井上 淳期	5580	規定あり 使用者負担あり 試料作製依頼:可	○	○ (条件あり)	
18 熱分析装置(DSC, TMA)	ThermoPlus EVO2 DSC, TMA・理学	2019	DSCは、試料の加熱冷却した際に生じる熱エネルギー変化を定量的に測定する。TMAは試料を加熱冷却した際に生じる膨張収縮等を測定する。	基盤研究支援センター(E7棟)	技術部 井上 淳期	5580	規定あり 使用者負担あり 試料作製依頼:可	○	○ (条件あり)	
19 X線回折装置(XRD)	RINT-2200V PC・理学電機	1998	集中方による粉末試料のX線回折図と平行ビーム法による薄膜のX線回折図が測定できる	基盤研究支援センター(E7棟)	技術部 堀田 将臣	5580	規定あり 使用者負担あり 試料作製依頼:可	○	○ (条件あり)	
20 イオンスパッタ装置	E-1045・日立	2008	走査電子顕微鏡で見る試料を製作するスペースとその作った試料を顕微鏡で見る際、チャージアップを防ぐために白金を蒸着させるための装置	基盤研究支援センター(E7棟)	技術部 井上 淳期	5580	規定あり 使用者負担あり 試料作製依頼:可	○	○ (条件あり)	
21 電界放射走査電子顕微鏡(FE-SEM)	SU8000・日立	2010	低加速電圧(100V)で試料表面の高分解能観察ができるリターディング機能、観察目的に合わせて3種類の検出器(TOP, UPPER, LOWER)で可視化できる。また、エネルギー分散型X線分析装置(EDX)を装備しており、微小領域の元素分析等が可能。	基盤研究支援センター(E7棟)	技術部 菊地 理佳	5126	規定あり 使用者負担あり 試料作製依頼:可	○	○	ナノテクノロジー プラットフォーム 事業登録機器
22 ネオオスミウムコーター	Neoc-ST・メイワフォーシス	2011	均一で広い負荷ロー領域内での高純度オスミウム金属被膜を形成させる装置	基盤研究支援センター(E7棟)	技術部 菊地 理佳	5126	規定あり 使用者負担あり 試料作製依頼:可	○	○ (条件あり)	
23 カーボンコーター	VS-100S・真空デバイス	2012	TEM, SEM, XMA用のカーボン蒸着装置切片や支持膜の補強、カーボン支持膜の作成、X線分析の際の導電蒸着などに使用	基盤研究支援センター(E7棟)	基盤研究支援センター長野分室 山上 朋彦	5126	規定あり 使用者負担あり 試料作製依頼:可	○	○ (条件あり)	
24 (低真空)走査電子顕微鏡	日立ハイテク FlexSEM1000	2017	低真空モードを備えた熱電子放出型SEM、EDS分析可能。	基盤研究支援センター(E7棟)	技術部 助川 公哉	5580	規定あり 使用者負担あり 試料作製依頼:可	○	○ (条件あり)	
25 微小硬度計	DUH-211・島津	2012	金属材料はもちろん、薄膜、イオン注入層、窒化層等の表面処理層、プラスチック・ゴム・セラミック等の非金属材料の表面強度試験に適用	基盤研究支援センター(E7棟)	技術部 堀田 将臣	5580	規定あり 使用者負担あり 試料作製依頼:要相談	○	○ (条件あり)	
26 オートグラフ	AG-IS 250kN・島津	2005	引張り、圧縮、曲げ、せん断特性等の精密測定が可能	基盤研究支援センター(E7棟)	技術部 堀田 将臣	5580	規定あり 使用者負担あり 試料作製依頼:要相談	○	○ (条件あり)	
27 (フーリエ変換)赤外分光光度計	ThermoFisherScientific Nicolet iS5	2014	有機化合物の定性分析	基盤研究支援センター(W2棟)	技術部 助川 公哉	5580	規定あり 使用者負担あり 試料作製依頼:可	○	○ (条件あり)	
28 デスクトップ型X線回折装置	理学 MiniFlex600	2020	定性・定量分析、結晶化度評価、配向評価等	基盤研究支援センター(W2棟)	技術部 助川 公哉	5580	規定あり 使用者負担あり 試料作製依頼:可	○	○ (条件あり)	
29 薄膜試料作製装置システム	日本電子 EM-09100IS	2020	透過電子顕微鏡用薄膜試料作製装置	基盤研究支援センター(W2棟)	技術部 南澤 比佳里	5126	規定あり 使用者負担あり 試料作製依頼:可	○	○ (条件あり)	
30 3Dプリンター	Formlabs Form3	2020	光造形3Dプリンター	基盤研究支援センター(W2棟)	技術部 堀田 将臣	5580	規定あり 使用者負担あり 試料作製依頼:可	○	○ (条件あり)	

国際科学イノベーションセンター(AICS)

設備・システム名	機器構成・型式・会社名	導入年度	用途・性能・概要等	設置場所	所属・管理者名	連絡先(内線)	利用規程・使用料金・依頼分析等	共同利用		
								学内	学外	備考
1 ICP質量分析装置	アジレント・テクノロジー G3663A/100 Agilent 8800 ICP-QQQ standard model	2015	元素分析、質量分析	地下 実験室2	水環境・土木工学科 竹内 健司	5626	規定あり 使用者負担あり 試料作製依頼:不可	○	×	

2	微小領域機械特性評価装置	オムロン・ナノテクノロジー・ジャパン ナノインテンション ハイストロントライボインテンター TI-950	2015	硬さ・弾性率の測定(機械特性評価)	地下 実験室4	学術研究・産学官連携推進機構 藤重 雅嗣	5664	規定:あり 使用者負担:あり 試料作製依頼:不可	○	○	
3	低圧細孔径分布測定装置	米国Porous Materials社 リキッドポロメーター LLP-1200A	2015	低圧細孔径分布測定	地下 実験室2	技術部 堀田 将臣	5580	規定:あり 使用者負担:あり 試料作製依頼:可	○	○	
4	ナノサイズ細孔径分布測定装置	西華産業 ナノポロメーター TNF-2W-100	2015	ナノサイズ細孔径分布測定	地下 実験室2	技術部 堀田 将臣	5580	規定:あり 使用者負担:あり 試料作製依頼:可	○	○	
5	ガスクロマトグラフ質量分析計	米国アルカー・ダルトニクス社 SCION SQ(456-GC)-SH GC/MS	2015	混合物の分離・成分測定	7階 産学共同実験室	先鋭材料研究所 田中 秀樹	5781	規定:あり 使用者負担:あり 試料作製依頼:可	○	○	
6	高速イオンクロマトグラフ	島津製作所 Prominence イオン分析システム HIC-SPNS	2015	混合試料の迅速な分離	7階 産学共同実験室	物質化学科 林 文隆	5781	規定:あり 使用者負担:あり 試料作製依頼:可	○	○	
7	ガス透過率測定装置	ジーエルサイエンスシステムガスクロマトグラフ GTME-2520(等圧法)	2015	ガス透過率測定	7階 産学共同実験室	物質化学科 林 文隆	5781	規定:あり 使用者負担:あり 試料作製依頼:可	○	○	
8	複合ビーム加工観察装置	日本電子 JIB-4610F ビックアップシステム付	2015	加工観察、高速分析	地下 実験室4	技術部 堀田 将臣	5580	規定:あり 使用者負担:あり 試料作製依頼:可	○	○	
9	オージェ電子顕微鏡	日本電子 フィールドエミッション オージェマイクロスコプ JAMP-9510	2015	状態分析	地下 実験室4	技術部 山上 朋彦	5580	規定:あり 使用者負担:あり 試料作製依頼:可	○	○	
10	飛行時間型二次イオン質量分析装置	独国ION-TOF社 TOF.SIMS5-ADSD-100	2015	質量分析	地下 実験室3	技術部 菊地 理佳	5580	規定:あり 使用者負担:あり 試料作製依頼:可	○	○	
11	自動接触角計	協和界面科学 DM-701M	2015	接触角、経時変化、自動液滴作成	6階 産学共同実験室	先鋭材料研究所 田中 秀樹	5781	規定:あり 使用者負担:あり 試料作製依頼:可	○	○	
12	カーボンコーター	メイワオーシス CADE-E/HSM 親水化処理機能付	2015	カーボン蒸着、親水化処理	地下 実験室1	物質化学科 林 文隆	5781	規定:あり 使用者負担:あり 試料作製依頼:可	○	○	
13	自動精密切断機	日本電子 アイノメット 11-1280-001	2015	材料の精密切断	7階 産学共同実験室	物質化学科 林 文隆	5781	規定:あり 使用者負担:あり 試料作製依頼:可	○	○	
14	レーザーラマン分光装置	堀場製作所 LabRAM HR evolution OS	2015	分子構造同定、物性評価	1階 カーボン膜形成室	電子情報システム工学科 橋本 佳男	5230	規定:あり 使用者負担:あり 試料作製依頼:可	○	○	ナノテクノロジープラットフォーム事業登録機器
15	比抵抗/ホール測定システム	東陽テクニカ 8400ACLR/OW型	2015	材料測定	1階 カーボン膜形成室	電子情報システム工学科 サイモーン ティ	5241	規定:あり 使用者負担:あり 試料作製依頼:可	○	○	ナノテクノロジープラットフォーム事業登録機器
16	高出力マイクロ波プラズマCVD装置	コーンステクノロジー社 AX6350	2015	ダイヤモンド製膜、窒化炭素製膜、カーボンナノチューブ、各種の気相プラズマ反応、エッチング、表面処理	1階 カーボン膜形成室	電子情報システム工学科 橋本 佳男	5230	規定:あり 使用者負担:あり 試料作製依頼:可	○	○	ナノテクノロジープラットフォーム事業登録機器
17	大気圧プラズマ装置	長野日本無線 NJZ-2820 XYステージ付	2015	表面洗浄、接着性向上、有機膜除去、表面油分の除去	1階 カーボン膜形成室	電子情報システム工学科 橋本 佳男	5230	規定:あり 使用者負担:あり 試料作製依頼:可	○	○	ナノテクノロジープラットフォーム事業登録機器
18	精密触媒制御ナノカーボン合成・分析装置	ULVAC CMS-50	2015	触媒粒子作成・評価、CVD処理、生成物の形状評価	1階 カーボン膜形成室	電子情報システム工学科 サイモーン ティ	5241	規定:あり 使用者負担:あり 試料作製依頼:可	○	○	ナノテクノロジープラットフォーム事業登録機器
19	X線電子分光分析装置	アルバックファイ QuanTera II	2014	状態分析	地下 実験室3	先鋭材料研究所 小畑 美智子	5587	規定:あり 使用者負担:あり 試料作製依頼:可	○	○	
20	試料水平型強力X線回折装置	SmartLab (株)カク	2018	微量粉末材料の測定	1階 カーボン膜形成室	物質化学科 林 文隆	5781	規定:あり 使用者負担:あり 試料作製依頼:可	○	○	